3G07

## 静電ポテンシャルを考慮した embedded cluster model の構築

(京大 ESICB<sup>1</sup>、京大 FIFC<sup>2</sup>) 〇松井 正冬<sup>1</sup>、榊 茂好<sup>1,2</sup>

## Development of an embedded cluster model incorporating electrostatic potential

(ESICB, Kyoto Univ.<sup>1</sup>, FIFC, Kyoto Univ.<sup>2</sup>) OMasafuyu Matsui<sup>1</sup> and Shigeyoshi Sakaki<sup>1, 2</sup>

【序論】 金属ナノ粒子を担体表面上に分散・担持した担持金属触媒の理論研究では、表面 全体を無限周期系として扱うスラブモデル、あるいは活性点近傍のみを孤立系として扱うク ラスターモデルが用いられてきた。スラブモデルでは hybrid 汎関数や波動関数理論を使用し た高精度電子状態計算が困難であり、クラスターモデルでは近傍部分以外の影響、特に表面 の作り出す長距離静電相互作用が取り込まれないなど、各々に問題がある。本研究ではクラ スターモデルにおけるこれらの問題を解決する試みとして、スラブモデルにより求めた静電 ポテンシャルをクラスターモデルに作用させる「埋め込みクラスターモデル(embedded cluster model)」の開発を行った。Rh<sub>2</sub>/AlPO<sub>4</sub> と Rh<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の埋め込みクラスターモデルを構築し、金 属-担体表面間相互作用をクラスターモデルで記述できるか、また静電場はその相互作用にど のような効果をもたらすかについて検討した。

【表面モデルと計算手法】 Rh<sub>2</sub>/AIPO<sub>4</sub> と Rh<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> スラブモデルは過去の研究<sup>1</sup>で構築した ものを用いた。Rh<sub>2</sub>/AIPO<sub>4</sub>のクラスターモデルは、Rh<sub>2</sub>/5(AIPO<sub>4</sub>), Rh<sub>2</sub>/15(AIPO<sub>4</sub>) をスラブモデ ルの構造から切り出した。静電ポテンシャルへの埋め込みに関しては、スラブモデルの原子 位置に点電荷を配置し、数百Å程度までクラスターを取り囲むことで静電ポテンシャルを表現 し、遠距離からの静電相互作用を取り込んだ。点電荷には、スラブモデルで求めた Bader 電 荷を用いた。Rh<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>のクラスターモデルは、Rh<sub>2</sub>/12(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) をスラブモデルの構造から切り 出し、静電ポテンシャルへの埋め込みは Rh<sub>2</sub>/AIPO<sub>4</sub> と同様の手法を用いた。計算には VASP と gaussian09 を使用した。

【結果と考察】 これまでに行われたスラブモデルによる金属-担体表面間相互作用の理論 研究から、Rh<sub>2</sub>/AlPO<sub>4</sub>では Rh<sub>2</sub>吸着に伴う構造変化により担体表面の最低非占有バンドのエネ ルギー準位が低下するとともに表面 Al に局在化して、Rh<sub>2</sub>から担体表面への電荷移動相互作 用が増大すること、Rh<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>では最低非占有バンドのエネルギー準位が高いため Rh<sub>2</sub>/AlPO<sub>4</sub> に比べて電荷移動が弱いことが明らかにされている<sup>1</sup>。図1(a) に示すように AlPO<sub>4</sub>の5ユニ ットを用いた Rh<sub>2</sub>/5(AlPO<sub>4</sub>)クラスターモデルでは、Rh<sub>2</sub>--担体表面間相互作用エネルギーは考 慮する点電荷数に強く依存し、点電荷数約 100 万点まで考慮する必要があることが示された。 これは 500 Å 程度離れた距離からの静電相互作用まで考慮することに対応している。図1(b)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Matsui, M. Machida, and S. Sakaki, J. Phys. Chem. C, 2015, 119, 19752–19762.

に示すように、HOMO-LUMO のエネルギーも静電ポテンシャルへの埋め込みにより大きく 変化している。LUMO の形状も静電ポテンシャルに大きく影響され、静電ポテンシャルを考 慮しない孤立モデルでは LUMO はクラスター末端とバルクとの境界領域に存在する(図 2 (a)) が、埋め込みモデルでは LUMO は Rh<sub>2</sub>と相互作用する Al 上に局在化し (図 2 (b))、スラ ブモデルと同じ描像 (図 2(d)) が得られた。このとき相互作用エネルギーは、孤立モデルでは -9.2 eV となるが埋め込みモデルでは-6.0eV となり、静電ポテンシャルの考慮によりスラブモ デルの結果 (-5.3 eV) に近い値が得られた (表 1)。より吸着点近傍を大きく切り出した Rh<sub>2</sub>/15AlPO<sub>4</sub>クラスターモデルにおいても、LUMO の形状 (図 2(c))、相互作用エネルギー (-5.6 eV) ともにスラブモデルのそれらに近い。

Rh<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>については、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の12ユニットを用いた Rh<sub>2</sub>/12(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 埋め込みクラスターモ デルを構築し、同様の検討を行った。HOMO, LUMO は、孤立モデルではクラスター末端の 境界領域に現れるが、埋め込みモデルでは Rh<sub>2</sub>吸着位置近傍に局在化し、スラブモデルと同 様の描像が得られた。相互作用エネルギーは-6.0 eV となり、スラブモデルの結果 (-5.4 eV) に 近い (表1)。

当日はスラブモデルにより求めた静電ポテンシャルを、Poisson 方程式と Fourier 変換を用 いてクラスターモデルの1電子演算子に作用させる埋め込みモデルの開発に関しても発表す る予定である。



の点電荷数依存性



図 2: AIPO<sub>4</sub>の LUMO: (a) 5AIPO<sub>4</sub> 孤立モアル, (b) 5AIPO<sub>4</sub>埋め込みモデル, (c) 15AIPO<sub>4</sub>埋め込み モデル, (d) スラブモデル.

表1: (a) Rh<sub>2</sub>/AlPO<sub>4</sub>, (b) Rh<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の孤立、埋め込み、スラブモデルでの 相互作用エネルギー (E<sub>int</sub>), HOMO-LUMO エネルギー (E<sub>HOMO</sub>, E<sub>LUMO</sub>)

		Rh <sub>2</sub> /AlPO <sub>4</sub>			Rh <sub>2</sub> /Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		
	functional	$E_{int}$	E <sub>HOMO</sub>	E <sub>LUMO</sub>	$E_{int}$	E <sub>HOMO</sub>	$E_{LUMO}$
孤立モデル 埋め込みモデル 埋め込みモデル スラブモデル	B3LYP B3LYP PBE PBE	-9.17 -5.97 -5.98 -5.29	-7.21 -10.19 -9.11 -7.12	-6.74 -8.35 -8.70 -6.27	-9.79 -5.51 -5.99 -5.44	-5.89 -8.32 -7.29 -5.66	-5.51 -4.83 -5.48 -4.06